(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-11607

(43) 公開日 平成6年(1994) 1月21日

(51) Int.CL⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 B 5/18

9018 - 2K

審査請求 未請求 請求項の数5(全 11 頁)

(21)出願番号

特願平4-170836

(71)出願人 000002897

(22)出願日

平成4年(1992)6月29日

大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72)発明者 植田健治

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号大

日本印刷株式会社内

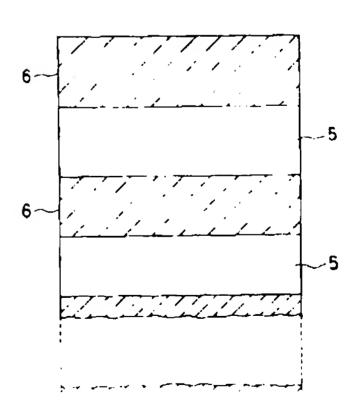
(74)代理人 弁理士 韮澤 弘 (外7名)

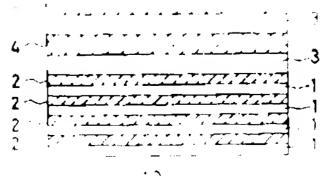
(54) 【発明の名称】 回折格子の製造方法

(57)【要約】

【目的】 屈折率差のある2種類以上のポリマー層を一部の層間で厚みが異なるように積層することにより、広い波長範囲の回折が可能な回折格子を製造する。

【構成】 屈折率の異なる2種以上のポリマーからなる層を屈折率が相対的に高・低と繰り返すように、高屈折率ポリマー層1、3、5と低屈折率ポリマー層2、4、6を順にコーティング法により積層して作製する。層間の厚さを異ならせて積層することにより、回折波長範囲を例えば800nm~2000nmにすることができ、この場合は、可視光を透過し熱線を反射する良好な熱線反射膜となる。その他 可規領域の特色性長の火を反射





【特許請求の範囲】

【請求項1】 - 屈折率の異なる2種以上のポリマーから なる層を屈折率が相対的に高・低と繰り返すように、高 屈折率ポリマー層と低屈折率ポリマー層を順にコーティ ング法により積層して作製することを特徴とする回折格 子の製造方法。

【請求項2】 ポリマー層の厚さを少なくとも一部の層 間で異なるように作製し、広い波長範囲の回折ができる ことを特徴とする請求項1記載の回折格子の製造方法。

【請求項3】 ポリマー層を、加熱乾燥可能で隣接する 10 ポリマー層を溶解しない溶媒に溶解されたポリマー溶液 をコーティングすることにより作製することを特徴とす る請求項1又は2記載の回折格子の製造方法。

【請求項4】 ポリマー層を、電離放射線の照射により ポリマー膜を形成できる電離放射線硬化型の液体をコー ティングすることにより作製することを特徴とする請求 項1又は2記載の回折格子の製造方法。

【請求項5】 コーティング法としてスピンコーティン グを用いることを特徴とする請求項1から4の何れか1 項記載の回折格子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【産業上の利用分野】本発明は、回折格子の製造方法に 関し、特に、熱線反射膜のように広い波長範囲の回折を する回折格子の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の回折格子としては、フォトポリマ 一、重クロム酸ゼラチン、銀塩等の膜に光の干渉縞を記 録して形成したブラッグ回折格子がよく知られている。 しかし、これらは何れも回折波長の範囲が狭く、広い波 30 長範囲の回折が可能なものは得られていない。

【0003】このようなブラッグ回折格子を熱線反射膜 等の用途に用いるには、回折波長が数百ヵm以上の範囲 にわたる必要がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような状 況に鑑みてなされたものであり、その目的は、屈折率差。

0. $13 \times 2 \times 5 + 0$. $14 \times 2 \times 5 + \cdots + 0$. $67 \times 2 \times 5$

[0008]

この回折格子10により、図2に示すように、第1の厚 40 られるが、何れのコーティング法も本発明に適用でき さの層の組1、2により、800nmの波長の光を回折。

一份、職員、曹操製 (1993年) 定することができる。

【0009】このような層構成を得る手段としては、ロ ールコーティング、グラビアコーティング、ダイコーテ the state of the s 一位物種をクラー ションマル (特別の)

*のある2種類以上のポリマー層を一部の層間で厚みが異 なるように積層することにより、広い波長範囲の回折が 可能なブラッグ回折格子を製造する方法を提供すること である。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決する本発 明の回折格子の製造方法においては、少なくとも一部の 層間で厚さを異ならせて積層された屈折率差のあるポリ マー層の作製方法において、塗布手段としてスピンコー ト法を用い、膜厚の制御を、塗布溶液の粘度やスピンコ ートの回転数を変化させることにより行うものである。 そのため、回折効率及び回折波長を、ポリマー膜の膜 厚、積層数、屈折率差を変えることにより、任意に設定 することができ、極めて簡便で、応用範囲の広い回折格 子作製方法である。

【0006】一般に、回折格子の格子間ピッチdと回折 波長 λ は、入射角を θ 、屈折率をnとすると、

 $2 \text{ nd s in } \theta = m\lambda \pmod{m=1, 2, 3 \cdots}$

で与えられる。したがって、屈折率の高い層と低い層を 20 交互に積層して回折格子を構成し、その際、格子間ピッ チdの異なる層を数種類作製することにより、種々の波 長の光を回折できるようにすることができ、1つの回折 格子の回折波長範囲を広げることができる。

【0007】具体的な例について説明すると、平均屈折 率が1.5の場合、図1に断面図を示すように、例え ば、 0.13μ mの高屈折率ポリマー層 $1(n_{\ell}=1)$ 59) に同じ厚みの低屈折率ポリマー層2 (na = 1. 41) を5組積層後、0.14 µmの高屈折率ポリマー 層3 (n₄ = 1.59) に同じ厚みの低屈折率ポリマー 層4 (n₄ = 1. 41) を5組積層し、厚みを順次大き くして同様に繰り返し積層し、0.67μmの高屈折率 ポリマー層 5 (na = 1, 59) と同じ厚みの低屈折率 ポリマー層 6 (n₄ = 1, 41) を 5 組積層して回折格 子10を作製する。このフィルム10の膜厚は、次の計 算から70μmとなる。

 $= 7.0 \, \mu \, \text{m}$

る。これらの中、特に好ましいコーティング方法は、膜

> 型材料溶液として、スピンコーディング独で塗布するの が望ましい。

> 【0011】まず、ポリマー溶液として塗布する場合に アプログラス から 溶液 ア発布する場合 さいとはい しい 多色を満たす このの変更した

てくる。

①ポリマーは、スピンコート後、加熱乾燥できる溶媒に 可溶である。

②2つのポリマーの屈折率が相互に異なる。

③1つのポリマーが溶けている溶媒が、他のポリマー膜を溶解しない。

これらの条件を満たすポリマーの組み合わせは、ポリマーハンドブック等を用いて、屈折率、溶媒、非溶媒を調べることにより決定できる。

【0012】本発明の製造方法に使用できるポリマーと しては、例えば、

1.4740

1-:

ポリビニリデンフルオライド		1.42
ポリジメチルシリレン (ポリジメチルシロキサン)		1.43
ポリトリフルオロエチルメタクリレート		1.437
ポリオキシプロピレン		1.4495
ポリビニルイソプチルエーテル		1.4507
ポリピニルエチルエーテル		1.4540
ポリオキシエチレン		1.4563
ポリピニルプチルエーテル		1.4563
ポリビニルペンチルエーテル		1.4581
ポリビニルヘキシルエーテル		1.4591
ポリ(4-メチル-1-ペンテン)	1.45	9 -1.465
セルロースアセテートプチレート	1.46	-1.49
ポリ(1-フルオロー2-トリフルオロメチルスチレン)		1. 16
ポリピニルオクチルエーテル		1.4613
ポリ(ビニル2-エチルヘキシルエーテル)		1.4626
ポリピニル デシル エーテル		1.4628
ポリ(2… メトキシエチルアクリレート)		1.463
ポリプチルアクリレート		1.4631
ポリプチルアクリレート		1.466
ポリ(tープチルメタクリレート)		1.4638
ポリビニルドデシルエーテル		1.4640
ポリ(3-エトキシプロピルアクリレート)		1.465
ポリオキシカルポニルテトラメチレン		1.465
ポリビニルプロピナネート		1.4665
ポリビニルアセテート		1.4665
ポリビニルマチルエーテル		1. 467
ポリエチルアクリレート		1.4685
エチレン・ピニルアセテート共重合体	1 17	-1.50
(80%-20%ピニルアセテート)	1. 11	1. (%)
セルロースプロピナネート	1 .17	-1.49
セルロースアセテートプロピオネート	2. 1.	1.47
ペンジルセルロース	1 47	-1.58
フェノール・フォルムアルデヒド樹脂		-1.70
セルローストリアセテート		-1.48
ポリビニルメチルエーテル (アイソタクティック)	1.41	1.4700
ポリ (3-メトキシブロピルアクリレート)		
		1. 471
		1 ***
・ ポリプロピレン (マタクティック、密度0.86%g/cm ²)。		1730
スティーロードマート・テーティング / Line 支持 Palin K / CIDE)		1. 4735

进行的对象 电子放大电流 电影

ポリ (ピニルserープチルエーテル) (アイソタクティック)

6

5

•		O
(ポリエチレンスクシネート)		
ポリテトラデシルメタクリレート		1.4746
エチレンープロピレン共重合体 (EPR-ゴム)	1.474	18-1.48
ポリヘキサデシルメタクリレート		1.4750
ポリビニルフォルメート		1.4757
ポリ (2 - フルオロエチルメタクリレート)		1.4768
ポリイソプチルメタクリレート		1.477
エチルセルロース		1.479
ポリピニルアセタール	1.48	-1.50
セルロースアセテート	1.48	-1.50
セルローストリプロピオネート	1.48	-1, 49
ポリオキシメチレン		1.48
ポリビニルプチラール	1.48	-1.49
ポリ(n – ヘキシルメタクリレート)		1.4813
ポリ (n - プチルメタクリレート)		1.483
ポリエチリデンジメタクリレート		1.4831
ポリ (2-エトキシエチルメタクリレート)		1.4833
ポリオキシエチレンオキシマレオイル		1.4840
(ポリエチレンマレート)		
ポリ(nープロピルメタクリレート)		1.484
ポリ(3,3,5-トリメチルシクロヘキシルメタクリレート)		1.485
ポリエチルメタクリレート		1. 485
ポリ (2・ニトロ 2-メチルプロピルメタクリレート)		1. 4868
ポリトリエチルカル ピニル メタクリレート		1. 4889
ポリ(1、1ージエチルプロピルメタクリレート)		1. 4889
ポリメチルメタクリレート		1. 4893
		1.490
ポリ(2-デシル-1、3-ブタジエン)		1.4899
ポリビニルアルコール	1 40	-1.53
ポリエチルグリコレートメタクリレート	1.49	
ポリ(3 - メチルシクロヘキシルメタクリレート)		1.4903
ポリ (シクロヘキシルαーエトキシアクリレート)		1.4947
- ペテスンプロスイングは、エピデンテラリレード/ - メチルセリロース (低粘度)		1. 4969
ポリ (4 - メチル) クロベキシルスタクリレート)		1.497
- ポップオスチレングリコールジメククリレート/ - ポリデカスチレングリコールジメククリレート		1.4975
- ポリウレタン		1.4990
ポリ (1, 2ープタジエン)	1.5	
		1.5000
ポリビニルフォルマール - ポリファブロエー 4 - トリコルセロフェルファン		1.50
ポリ (2-プロモー4ートリフルオロメチルスチレン)	<u></u>	1.5
セルロースニトレート	1.50	-1.514
ポリ(secープチルαークロロアクリレート)		1.500
ポリ(2~~ブチルー1、3~ブタジエン)		1. 5000

ボリインプェン 1.5059 ボリボルニルメタフリレート 1.5059

· :

(3)		1 2 B
7		8
ポリシクロヘキシルメタクリレート		1.5066
ポリ(シクロヘキサンジオールー1, 4ージメタクリレート)		1.5067
プチルゴム (未加硫)		1.508
ポリテトラハイドロフルフリルメタクリレート)		1.5096
グッタペルカ (β)		1.509
ポリエチレンアイナノマー		1.51
ポリオキシエチレン (高分子量)	1.51	-1.54
ポリエチレン (密度0.914 g·cm³)		1.51
(密度0.94-0.945g / c m³)	1.52	-1.53
(密度0.965 g/cm³)		1.545
ポリ (1-メチルシクロヘキシルメタクリレート)		1.5111
ポリ (2-ヒドロキシエチル /タクリレート)		1.5119
ポリビニルクロロアセテート		1.512
ポリプテン (アイソタクティック)		1.5125
ポリピニルメタクリレート		1.5129
ポリ (N - ブチルーメタクリルアミド)		1.5135
グッタペルカ (α)		1.514
テルペン樹脂		1.515
ポリ (1、3ープタジエン)		1.5154
セラック	1.51	-1.53
ポリ (メチルα-クロロアクリレート)		1.517
ポリ (2-クロロエチルメタクリレート)		1.517
ポリ (2-ジエチルアミノエチルメタクリレート)		1.5174
ポリ (2 - クロロシクロヘキシルメタクリレート)		1.5179
ポリ (1, 3-プタジエン) (35%cis;56%trans	,	1.5180
; 7%1, 2-contet)		
天然ゴム	1.519	-1.52
ポリアリルメタクリレート		1.5196
ポリピニルクロライド+40%ジオクチルフタテート		1.52
ポリアクリロニトリル		1.52
		1.5187
ポリメタクリロニトリル		1.52
ポリ (1, 3ープタデエン) (s:ご型リッチ)		1.52
プタジエンーアクリロニトリル共重合体		1.52
ポリメチルイソプロペニルケトン		1.5200
ポリイソプレン		1.521
ポリエステル樹脂 リジッド (約50)ネスチレン)	1. 523	-1.54
ポリ (N-(2-メトキシエチル) メタクリルアミド)		1.5246
ポリ(2、3ージメチルブタジエン)(メチルゴム)		1.525
ピニルクロライドーピニルアセテート共重合体 (95/5-90/10)	1. 525	-1. 535
ポリアクリックアンド		1.527
ポリ(1、3~ジクロロプロピルメタクリレート)		1. 5270
		•

塩酸化二、

. . サイロン6、サイロン6、6・サイロン6、10 (成型体) 1.63 (ナイロシー6ーファイバ:1.515 横断方向

to the contract of the contract of

9	10
プロック共重合体	
ポリ(シクロヘキシル α ークロロアクリレート)	1.532
ポリ(2 - クロロエチル α - クロロアクリレート)	1.533
プタジエンースチレン共重合体(約75//25)	1.535
ポリ (2 - アミノエチルメタクリレート)	1.537
ポリフルフリル メタクリレート	1.5381
プロティン 1.539	-1.541
ポリプチルメルカプチルメタクリレート	1.5390
ポリ (1-フェニルーn-アミルメタクリレート)	1.5396
ポリ (N-メチル-メタクリルアミド)	1.5398
セルロース	1.54
ポリピニルクロライド 1.54	-1.55
1. 3	-1.56
ポリ (secープチルαープロモアクリレート)	1.542
ポリ (シクロヘキシル α – プロモアクリレート)	1.542
ポリ (2ープロモエチルメタクリレート)	1.5426
ポリジヒドロアビエチックアシド	1.544
ポリアピエチックアシド	1.546
ポリエチルメルカプチルメタクリレート	1.547
ポリ (N-アリルメタクリルアミド)	1.5476
ポリ (1-フェニルエチルメタクリレート)	1.5487
ポリピニルフラン	1.55
ポリ (2~ピニルテトラヒドロフラン)	1.55
ポリ (ビニルクロライド) +40%トリクレジルフォスフェート	1.55
19 7 IAI nle	-1.60
ポリ (pーメトキシベンジルメタクリレート)	1.552
ポリイソプロピルメタクリレート	1.552
ポリ (pーイソプロピルスチレン)	1.554
ポリクロロプレン 1.554	-1.558
ポリ (オキシエチレンーαーペンソエートーωーメタクリレート)	1. 555
ポリ (p, p'ーキシリレニルジメタクリレート)	1.5559
ポリ (1ーフェニルアリルメタクリンート)	1.5573
ポリ(ロー: クロペキ:/リフェニルメタクリレート)	1.5575
ポリ (2-フェニルエチルスタクリレート)	1,5592
ポリ (オキシカルボニロキ: ニー1、4・フェニレン コープロピル	1.5602
- ブチリデン・1、4ーフェニレン)	
ポリ(1-(0-クロロフェニル)エチルメタクリレート)	1.5624
スチレンー無水マレイン酸共重合体	1.564
ポリ (1-フェニルシクロヘキシルメタクリレート)	1.5645
ポリ(オキシカルボニロキシー1、4ーフェニレンー1、3	1.5671
-ジメチループチリデンー1、4-フェニレン)	
ポリ (メチルαープロモアクリレート)	1,5672
•	٠.
1. 1. 开始,1171年 - 1171年 - 1	
まり(オキシカルボコロキ) 1、4 フェニレンイソプチコデン	
-1, 4-7:エニレ。)	
	,

(7)	符
11	12
ポリ(o~クレジルメタクリレート)	1.5707
ポリジアリルフタレート	1.572
ポリ(2、3-ジブコモブロビルメタクリレート)	1.5739
ポリ (オキシカルボニロキシー1、4ーフェニレンー1ーメチル	1.5745
-プチリデンー1、4-フェニレン)	
ポリ (オキシー2、6ージメチルフェニレン)	1.575
ポリオキシエチレンオキシテレフタロイル (アモルファス)	1.5750
(ポリエチレンテレフタレート)	
(結晶性ファイバ:1.51横断)方向	
1.64ファイバ方向)	
ポリビニルベンソエート	1.5775
ポリ(オキシカルポニロキシー1、4ーフェニレンプチリデン	1. 5792
-1、4-フェニレン)	
ポリ(1、2-ジフェニルエチルメタクリレート)	1. 5816
ポリ (ロークロロペンジルメタクリレート)	1. 5823
ポリ (オキシカルボニロキシー1, 4-フェニレンーsec-	1. 5827
プチリデンー1、4-フェニレン)	1.0021
ポリオキシベンタエリスリトロキシフタロイル)	1.584
ポリ (m-ニトロペンジルメタクリレート)	1. 5845
ポリ (オキシカルボニロキシー1, 4 - フェニレンイソプロピリデン	
-1, 4-フェニレン)	1.0000
ポリ (N-(2-フェニルエチル) メタクリルアミド)	1. 5857
ポリ (4-メトキシー2-メチルスチレン)	1. 5868
ポリ(o-メチルスチレン)	1. 5874
ポリスチレン 1.50	1.5074
ポリ (オキシカルボニロキシー1、4ーフェニレンシクロヘキシリデ	
-1, 4-フェニレン)	Z 1. 5500
ポリ (ローメトキシスチレン)	1.5932
ポリジフェニルメチルメタクリレート	1.5932
ポリ (オキシカルボニロキシー1、4-フェニレンエチリデン	1. 5937
-1, 4-7x=\(\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc	1. 0937
ポリ (pープロモフェニルメタクリレート)	1 5064
ポリ (Nーコンジルスタケコルアミド)	1.5964
ポリ(pーストキシスチレン)	1.5965
硬化ゴム(32%8)	1.5967
.19.1.1.1.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	1.6
	-1.63
ポリ (o - クロロジフェニルメチルメタクリレート)	-1.7
ポリ (オキシカルボニロキシー1, 4-(2,6-ジクロロ)	1.6040
フェニレン・イソプロピリデン・1、4-	1.6056
(2, 6-ジャロロ) フェニレン)	
ポリ(オキシカルボニロキシピス(1、4~(3、5~	1 0050
47 (14) 74 (4) L4 (1, 4 - (5, 5 -	1, 6056
all the manufacture of the state of the stat	1
ポート (p - ジピニレベンゼン)	.612
ポリ (Nーピニルフタルイミド)	1.6150
	1.6200
	1.6918

13	14
ポリ (αーナフチルカルビニルメタクリレート)	1.63
ポリサルホン	1 633
ポリ(2-ピニルチオフェン)	1.6376
ポリ (αーナフチルメタクリレート)	1 6410
ポリ(オキシカルポニロキシー1,4-フェニレンジフェニル	1.6539
ーメチレンー1、4ーフェニレン)	
ポリピニルフェニルスルフィド	1.6568
プチルフェノールフォルムアルデヒド樹脂	1.66
ウレアーチオウレアーフォルムアルデヒド樹脂	1.660
ポリピニルナフタレン	1.6818
ポリビニルカルパゾール	1.683
ナフタレン一フォルムアルデヒド樹脂	1.696
フェノールーフォルムアルデヒド樹脂	1.70
ポリペンタプロモフェニルメタクリレート	1.71

等があげられる。なお、以上には、d線の屈折率 (na) も併せて示してある。

【0013】また、代表的溶媒としては、メタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、アシーン、メチルエチルケトン、メチルイソプチルケトン、エチレンクロライド、クロロホル 20ム、ベンゼン、トルエン、キシレン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、等の比較的沸点の低い有機溶媒や水があげられる。

【0014】電離放射線硬化型材料溶液として塗布する 場合については、以下のようである。電離放射線硬化型 材料としては、電子線硬化型樹脂及び紫外線硬化型樹脂 が有用であり、電子線硬化性樹脂と紫外線硬化性樹脂と は、後者が光重合開始剤と増感剤を含有することを除い て、成分的に同様なものであり、一般的には、皮膜形成 成分としてその構造中にラジカル重合性の活性基を有す。30 るポリマー、オリゴマー、モノマーを主成分とするもの で、粘度では、2000cps以下であることが望まし い。このようなポリマー、オリゴマーとして、ウレタン アクリレートやポリエステルアクリレートのような市販 品から容易に入手可能なものが本発明に適用可能であ る。モノマーとしては、市販のアクリル酸又はメタクリ ル酸誘導体等の電離放射線硬化型モノマーが本発明に適 用可能である。上記の硬化樹脂を紫外線硬化性樹脂とす るためには、この中に光重合開始剤として、アセトフェ ノン類、ペンプフェノン、ミヒラーペンパイルペンパエ 40 る製造方法である。 一ト、αーアミノキシムエステル、テトラメチルチウラ ムモノサルファイド、チオキサントン額や、光増感剤と

トロン型、高周波型等の各種電子線加速機から放出される $50\sim1$, $000 \, {\rm KeV}$ 、好ましくは、 $100\sim30 \, {\rm OKeV}$ のエネルギーを有する電子線を、 $0.1\sim10 \, {\rm OMrad}$ 、好ましくは、 $1\sim10 \, {\rm Mrad}$ 、照射すことにより硬化させることができ、また、紫外線照射の場合は、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、カーボンアーク、キセノンアーク、メタルハライドランプ等の光源から発せられる紫外線を、 $0.1\sim10$, $000 \, {\rm mJ/cm^2}$ 所引することにより硬化させることができる。

【0016】一般に、スピンコーティング法では、コーティング膜厚hは、

 $h = K \mu^{0.36} \omega^{-0.50}$ (E λ / C_D) 0.60

で与えられる。ここで、K:定数、 $\mu:$ 塗工剤粘度、 $\omega:$ スピンナーの角速度、E:相対蒸発速度、 $\lambda:$ 蒸発潜熱、 $C_{\wp}:$ 熱容量である。

【0017】したがって、ポリマー膜を所定の厚さに塗布する条件は、予め、ポリマー溶液を所定の粘度と回転数で塗布することにより膜厚と回転数の関係を求めておくことにより、決定することができる。

【0018】以上の説明から明らかなように、本発明の回折格子の製造方法は、屈折率の異なる2種以上のポリマーからなる層を屈折率が相対的に高・低と繰り返すように、高屈折率ポリマー層と低屈折率ポリマー層を順にコーティング法により積層して作製することを特徴とする製造方法である。

【0019】この場合、ポリマー層の厚さを少なくとも 一部の層間で異なるように作製することが、広い波長節

_4, *

市民、県工、陸市した後、電離放射等を増長、ることにより、ポーマー層を生成する。電離放射線理射力法としては、従来の技術がそのまま適用でき、例えば電子線照射が場合は、アーカンドントンサート、型、コンデザラマナー中振楽日本、連載に「今日器や、直線や、アド

may the state of t

4. 操作 高维。

密破をコープイングすることにより作製するか、スパ、 電離放射線の照射によりボリマー膜を形成できる電離放 射線硬化型の液体をコーティングすることにより作製す

网络公谷科

 15

し難い場合は、コロナ処理、オゾン処理等の表面処理を 行うことにより解決できる。

【0022】なお、コーティング法としてスピンコーテ ィングを用いるのが望ましい。

[0023]

【作用】本発明においては、屈折率の異なる2種以上の ポリマーからなる層を屈折率が相対的に高・低と繰り返 すように、高屈折率ポリマー層と低屈折率ポリマー層を 順にコーティング法により積層して作製するので、層間 い回折格子を容易に作製することができる。

[0024]

【実施例】以下、本発明の回折格子の製造方法の実施例 について説明する。

実施例1

高屈折率ポリマー層としてポリスチレン (PSt, na = 1. 592) を、低屈折率ポリマー層としてポリヒド*

*ロキシエチルメタクリレート (PHEMA, $n_d = 1$. 46) を用いて、800nm~2000nmの波長の光 を回折するように、 $0.129 \mu m \sim 0.327 \mu m \sigma$ 間で0 033のピッチの膜厚で、各膜厚につき20組 の屈折率高、低の層からなる多層ポリマー層を作製し た。

16

【0025】ここで、PStは分子量10万の市販品 (デンカ社製)を5%のジオキサン溶液(粘度:10. 0cps)として、PHEMAは分子量10万の合成品 の厚さを異ならせて積層することにより、回折波長の広 10 を7%のメタノール溶液(粘度:12.3cps)とし て塗布した。なお、PHEMAは、メタノール中モノマ 一濃度30%で、開始剤(V-65:和光純薬工業社 製)を0.1%用いて、ラジカル重合することにより合 成した。

> 【0026】各膜厚に対するPSt、PHEMAのスピ ンコートの条件を下表に示す。

[0027]

膜厚	PS t	PHEMA
(μm)	(rpm)	(r pm)
0.129	6 2 5	1331
0.162	4 0 0	8 5 2
0.195	278	592
0. 228	204	435
0.261	156	3 3 2
0. 294	1 2 3	262
0. 327	100	2 1 3

得られた回折格子の回折効率を、分光光度計 (UV-3 30※【0028】実施例2 65:島津製作所社製)で測定したところ、800nm ~2000mmの範囲で平均で48%の回折効率を持つ ことが分かった。

高屈折率ポリマー層、低屈折率ポリマー層として、以下 に示す電離放射線硬化型組成物を使用した。

高屈折率ポリマー層

ウレタンアクリレート (PR-202:三菱化成社製)・・・ 50重量部 2, 4, 5-トリプロモフェノールメタクリレート・・・150 重量部

[0029]

(和光純薬工業社製)

ジペンタエリスリトールペンタアクリレート 6量量

(サートマー399:サートマー社製)

· u/.

粘度:10cps, 屈折率:1.58

低屈折率ポリマー層

ウレタンアクリレート (PR-202:三菱化成社製)・・・ 50 重量部

正量法

プログラン みかいしか しょく 石製

粘度: 8 c p s 。屈折率: 1、4 7

各膜厚に対する高屈折率、低屈折率材のスピンコートの 【0030】

本作がおおけっぽ

膜厚	高屈折率材	低屈折率率材
(μm)	(rpm)	(rpm)
0. 129	2500	2 1 8 7
0.162	1600	1 4 0 0
0.195	780	973
0. 228	8 1 6	714
0.261	6 2 4	5 4 6
0. 294	492	4 3 0
0. 327	400	350

各層は、スピンコーティング後、電子線を5Mrad. 照射する(ESI社製)ことにより硬化させ、ポリマー 層とした。各膜厚について、高屈折率層、低屈折率層を 交互に10組ずつ積層し、回折格子を作製した。

【0031】得られた回折格子の回折効率を、分光光度 計(UV-365:島津製作所社製)で測定したとこ ろ、800nm~2000nmの範囲で平均で52%の 回折効率を持つことが分かった。

[0032]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 の回折格子の製造方法によると、屈折率の異なる2種以 上のポリマーからなる層を屈折率が相対的に高・低と繰 り返すように、高屈折率ポリマー層と低屈折率ポリマー 層を順にコーティング法により積層して作製するので、 層間の厚さを異ならせて積層することにより、回折波長 の広い回折格子を容易に作製することができる。

【0033】具体的には、回折波長範囲を例えば800 $nm\sim2000nm$ にすることができ、この場合は、可 30 5…膜厚0.67 μ mの高屈折率ポリマー層(na = 視光を透過し熱線を反射する良好な熱線反射膜となる。 この熱線反射膜を自動車や建物の窓に用いることによ り、車内及び室内の温度の上昇を低減することができ る。

【0034】また、このような熱線反射フィルム以外の 用途として、可視領域の特定波長の光を反射する液晶デ ィスプレー等用のカラーフィルターや、紫外線カットフ ィルム等にも応用可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の製造方法により製作された回折格子の 1つの具体例の積層断面図である。

- 【図2】図1の回折格子の回折特性を示す図である。 【符号の説明】
 - 1…膜厚 0. 13μmの高屈折率ポリマー層 (n_d =
 - 1. 59)
 - 2…膜厚 0. 13μmの低屈折率ポリマー層 (n_d =
 - 1. 41)
 - 3…膜厚0. 14μmの高屈折率ポリマー層 (n_d =
 - 1.59
 - 4…膜厚0. 14μmの低屈折率ポリマー層 (n_d =
 - 1. 41)
- - 1.59
 - $6…膜厚0.67 \mu m の低屈折率ポリマー層(n_{\bullet} =$ 1. 41)
 - 10…回折格子 (膜厚70μm)

